#### PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number:

54103463 A

(43) Date of publication of application: 14.08.1979

(51) Int. CI

B29B 3/04

(21) Application number:

53010245

(71) Applicant: UNITIKA LTD

(22) Date of filing:

31.01.1978

(72) Inventor: SHIMOMORI KENICHI

> **HASEGAWA MAKOTO FUJIMOTO TAKEO TSUJI TSUNENORI**

#### (54) CONTINUOUS COUNTERCURRENT DRYING OF SYNTHETIC RESIN CHIPS

(57) Abstract:

PURPOSE: To eliminate the variation of amount of synthetic resin chips retained in a continuous countercurrent drying tower and to obtain the chips free from uneven drying, by feeding constant amounts of an extractant and the chips after dehydration to the tower top continuously.

CONSTITUTION: Synthetic resin chips fed from the pipeline 2 to the scouring tower 1 are brought into contact with an extractant which is fed from the pipeline 3 and discharged from the pipeline 4 countercurrently, fed through the pipeline 5 to the top of the dehydrator 6 together with part of the extractant, and dehydrated. The extractant is discharged from the pipeline 7, and the chips are fed from the pipeline 8 to the top of the continuous countercurrent drying tower 9. The flow rate of a drying inert gas is controlled by the control valve 22 drivingly connected through the controller 21 to the pressure detector 20 at the top of the tower 9 so that the top pressure of the tower 9 may be constant. The gas is fed from the blower 17 through the heat exchanger 18 and the pipeline 23 to the bottom of the tower 9 and brought into countercurrent contact with the chips flowing down the tower 9.

COPYRIGHT: (C)1979, JPO& Japio

# ⑩公開特許公報(A)

昭54—103463

50Int. Cl.2 B 29 B 3/04 識別記号

**10**日本分類 25(5) **B** 33

庁内整理番号 43公開

昭和54年(1979)8月14日

7005-4F

発明の数 1 未請求 審査請求

(全 4 頁)

の合成樹脂チップの連続向流乾燥方法

(2)特

昭53-10245

29出

昭53(1978)1月31日 願

明 者 個発

下森研一 宇治市宇治戸ノ内33

同

長谷川誠

宇治市宇治米坂21-25

藤本武男 明 者 79発

宇治市槇島町郡9-1

辻常徳 同

城陽市寺田深谷7-194

ユニチカ株式会社 願 他出

尼崎市東本町1丁目50番地

柳

1 発明の名称

合成樹脂チップの建統向流乾燥方法

#### 2.特許闘求の範囲

(1)乾燥格頂部に連結された脱水機に精錬格下部の 内圧により抽剤と共に供給された合成細脂チップ を脱水機にて脱水処理後乾燥塔頂部より供給し、乾 燥格下部または下部および中部より供給される乾 燥用不活性ガスと向流接触せしめ乾燥処理を行な い次ので乾燥格下部からそれに連結されたストッ クタンクに乾燥合成樹脂チップを運統的に排出せ しめるようにした避税向流乾燥方法に於いて、乾 燥塔頂部の内圧の変動値により、乾燥塔に供給す る乾燥用不活性ガスの供給量を調節することを特 後とする合成物脂チップの連続向流乾燥方法。

## 5. 発明の静綱な説明

本発明は合成極脂チップの連続向流乾燥方法に 関するものであり、脱水機に供給する抽剤及び合 成樹脂チップ登を常に一定になし脱水処理を均一 に行なりと共に、乾燥塔頂部へ供給する合成樹脂

チップ量を常に一定となすことにより単統向流乾 燥塔内のチップ滞留量の変動をなくし、乾燥斑の ない合成樹脂チップをみる方法を提供するもので

従来、重合工程で得られた合成物脂チップが多 盤の単量体や低重合体を含有している場合、例え はナイロン6チップの場合は水等の抽剤により特 線処理を行ない前記単位体や低監合体を抽出除去 し次いで乾燥処理を施した後裔融押出工程に供し ている。これら一連の処理を能率良く且つ経済的 に実施するには、精錬処理を行なった合成樹脂チ ップは精錬塔下部の内圧により脱水機まで抽剤と 共に供給し、乾燥処理に娶する熱量をできるだけ 少なくするために脱水処理を行なってから乾燥塔 に供給している。また、乾燥塔での乾燥処理は能 串の良い連続向流乾燥方法が用いられ、乾燥後の 合成樹脂チップは風送により溶触押出工程まで送 られるが、該風送に使用する風量を少なくし、且 つ溶融押出工程での必要時に必要登送ることがで きるように、更に風送配管経路の簡便化及び風送 配管系統切り替え時、合成樹脂チップの誰り等のトラブルが発生しないよう、連続向流乾燥等下部 にストックタンクを連結し、乾燥将下部から連続的に排出される乾燥合成樹脂チップを前配ストックタンクに貯留しておいて、溶験押出工程の必要時に必要量だけ間欠的に輸送する方法が用いられている。

そとで本発明者らは上記事態の起とる原因につ

- 3 <del>-</del>

を試みた結果、脱水機に供給する抽剤及び合成樹脂チップが停止するととはなかったが逆圧は遡及している為供給量を一定にすることはできず、また脱水処理能力の大きい脱水機を使用しなければ、逆圧がない場合、すなわち合成樹脂チップの及ど停止時に脱水処理が不十分な含水率の高い合成樹脂チップやひどい場合には抽剤が連続向流乾燥塔内に入り乾燥器の原因となりこの方法もあまり好ましくなかった。

そこで本発明者らは合成樹脂チップ及び抑剤が 常に一定量脱水機に供給され、十分且つ均一な脱 水処理が施された後遅続向流乾燥塔へ供給される 方法を見出すべく更に鋭敏検討の結果、本発明に 到送したものである。

即ち、本発明の要点は乾燥塔内頂部の圧力を検知して乾燥塔に供給する乾燥用不活性ガスの供給費を関節し、酸乾燥塔内頂部の圧力を一定にすべく調節してストックタンクから溶酸押出工程へ乾燥合成物脂チップを風送する際の逆圧の避及を乾燥塔内にて消失させるようにしたことにあり、こ

1034031-1034031-27 いて検討した結果、ストックタンクから溶酸押出 工程へ乾燥合成虧脂チップを風送すべく、風送用 流体の供給を開始するとチップ送り方向に対する 逆圧がストックタンク内、連続向流乾燥格内及び 脱水機内に遡及し、チップの風送を始めると更に 大きな逆圧が遡及し、それぞれの内圧を上昇せし めることによるものと判明した。

- 4 -

れにより脱水機内の内圧は常に一定に保持される
為脱水機に供給される抽剤及び合成樹脂チップの
供給量は変動、停止することがなくなった。したがつて乾燥塔内の合成樹脂チップの食にも変動が
に行なわれ、乾燥塔内のチップ滞留量にも変動が
なく乾燥斑の減少にも効果があると共に、合成樹脂チップの褶盤が低下した際、定常状態に戻す
ためストックタンクへの供給を一時停止するといった選転管理面に支障をきたす事態もなくなった。

の吹き上げ流は連続向流乾燥塔下部に選するまで に乾燥塔下部から排出される合成樹脂チップから 熱を撃い乾燥塔内に供給する熱量も乾燥度を生ず るほどの差ではなかったものと考えられる。

次に本発明を図面により説明する。第1図は本 発明の一実施態様図を示すものである。単盤体及 び低重合体を含む合成樹脂チップは配管(2)より精 練塔(1)内に供給され、配管(8)より供給されて配管 (4)より排出される抽剤と向流接触しながら精練塔 (1)内を流下し、精練され、精練塔下部より、一绺 が精練塔(1)の下部、他婚が脱水機(6)の上部に連結 された配管(5)内を、配管(8)から供給される抽剤の 一部とともに移送され脱水機(6)の上部に供給され る。配管(8)から供給する抽剤の圧力すたわち稍額 塔(1) 下部の圧力は精練条件、脱水機(6)の処理能力 及び設置位置により最適値に設定する。また脱水 概(6)の構造はいかなるものでも良いが特公昭36一 9165 公報の図中 13 に示されているような合成 樹脂チップと抽剤を大きかに分離した後チップの みを遠心脱水機に供給する2段の脱水処理を行な

- 7 <del>-</del>

性ガスは送風機切で送られ熱交換器阀で加熱され 配管网を通り連続向流乾燥塔(9)下部から塔内に供 給され上昇しながら流下してくる合成樹脂チップ と向流接触し乾燥塔(9)頂部より配管側を超って除 設器 Wi を 経た後再び 送風機 切により 乾燥 塔 (9) 下部 に循環供給されるが乾燥塔(9)上部には圧力検出端 対が設けられており、該圧力検出端四は制御器包 を介して乾燥用不活性ガス補給盤コントロール弁 図と運動しており、コントロール弁図により乾燥 塔(9)頂部圧力が一定になるよう圧力検出端四の検 出位に見合った乾燥用不活性ガスの流量を調節し 配管因から配管因へ乾燥用不活性ガスを補給して いる。尚除湿器側は配管側中に取り付けてもよい。 図は経済性を考え乾燥用不活性ガスは循環系とし ているが、本発明では乾燥用不活性ガスは循環系 でなくても良いことはいうまでもない。ただし領 双系でない場合は、循環する乾燥用不活性ガスが ない為肜大な乾燥用不活性ガスが必要となる。 奥施例 1

第1回に示す装置を使用して精練塔(1)からの精

**うととが好ましい。脱水機(8)で分離された抽剤は** 配管(7)より排出され脱水処理された合成樹脂チョ プは配管(8)を通って連続向流乾燥塔(9)内頂部に供 給され、乾燥塔(0)内を流下し下部の配管44からロ - タリーメルブ四を介して均一にストックタンク 個へ排出される。ストックタンク個内の合成樹脂 チップの風送仔止時は、ロータリーパルブ四の回 転は停止しているが酸チップを溶酸押出工程へ供 給する場合は、まず送風機関の運転を開始し風送 配管网に送風した後にロータリーパルブ四を回転 し風送配管网へ合成御脂チップを供給し、送風機 悶からの遊体により裕敵押出工程に風送する。ス トックタンク国からの配管川に取り付けられたロ ョリ - メルブ個はダンパーペンのようなもので あってもよく、要はストックタンク悩から風送用 配管側に合成樹脂チップを間欠的に供給、停止が できる装置であればよい。図はストックタンクを 1個設けたものであるが2個以上設けてもよいこ とはいうまでもない。また送風樹崎からの流体は 窒素ガス等の不活性ガスが好ましい。乾燥用不活

<del>-</del> 8 <del>-</del>

銀済ナイロン6チップを 150岁/hr で脱水機に供給(チップ:水一1:1、凶中 A 点の水圧 0.45岁/cm²·G )し、脱水処理した未乾燥チップを連続向流乾燥塔(B)に供給し、滞留時間 2 0 時間で乾燥し連続向流乾燥塔から連続的にストックタンク(4)へ排出した。乾燥用不活性ガスとしては 110 ℃の窒素ガスを用い、乾燥用不活性ガスとしては 110 ℃の窒素がスを用い、乾燥塔下部より 800 ㎡/hr 、空塔基 彩風速 0.5 m/seoで供給し、乾燥用不活性ガス循環系には新しい窒素ガスを 0.2 ㎡/mn を基準流量として常時確給した。

連続向流乾燥塔内頂部に設けられた圧力検出盤 (2)で上部圧力値を検出し、該圧力値に応じて、新 しい窒素ガスの補給設定量を次式に従って変更制 御した。(検出圧力値は 0.35~0.45 kg/cm² の間 で変動した。)

 $\Delta W = (0.40 - P) \times 4.0$ 

P:圧力検出端による検出圧力値(タ/cm²・G)

ΔW:基準流量に対する補給ガスコントロール弁

の流量変更巾(m²/min)で正のときは上げ、

食のときは下げる。

特朗昭54-103463(4)

上配条件で10日間乾燥を実施したところ、その間連続向沈乾燥塔内のチップ滞留量の変化もなく、乾燥塔へのチップ供給の停止も発生しなかった。その間、20回サンプリングし乾燥チップの水分を測定したところ平均水分率0.085%、水分を動巾(1)0.008%であった。

尚、乾燥塔へ供給されるチップの含水率は14~15%であり、乾燥塔内上部温度は50~60℃の間で変動した。ことでいう上部温度とは合成樹脂チップの滞留時間で頂部から5時間の位置の温度である。

比較のため従来の方法である領 製系への新たな 窒素ガスの補給量を 0・2 m/min 一定にした場合は、連続向流乾燥塔内のチップ滞留量の変化があり、乾燥塔への停止が 9 回発生し、乾燥チップの平均 水分率は 0・084 %、水分変動巾側 0・020 % であった。

尚、乾燥塔へ供給されるチップの含水率は13 ~15%であり、乾燥塔内上部温度は50~70 ℃の間で変動した。

-11-

の送風機、四は熱交換器、四は圧力検出端、四は 割御器、四は乾燥用不活性ガス補給量コントロー ル弁、 (25)・(24)・(26) は乾燥用不活性ガス循環用 配管、 (25) は新たに補給する乾燥用不活性ガスの 供給用配管をそれぞれ示す。

特許出願人 ユニチカ株式会社

実施例に示す新しい窒素ガスの補給設定量の変 更制御式は各装置固有の実験式であり、また図に示す A 点の位置の水圧及び脱水機の処理能力の大 きさは合成樹脂チップの処理量に合わせて最適な ものを選べばよい。

乾燥用不活性ガスの供給量を調節する方法としては実施例に示した方法とは別に図中の送風機切の回転数を変化させる方法もある。

#### 4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明の一実施限様図を示すもので、 (1)は連続特線塔、(6)は脱水機、(6)は連続向流乾燥 塔、(4)はストックタンク、何は乾燥用不活性ガス

-12-

### 第1四

